



Echipament: Echipament tehnologic pentru procesarea în vid a unor straturi subțiri din nitrura de titan

Nume de catalog: Magnetron Sputtering

Anul: 2010

Producător: BESTEC GmbH, Germany

Domeniu de utilizare:

- ➔ Pulverizarea în regim magnetron standard este o tehnică flexibilă care poate fi folosită pentru depunerea unei game largi de materiale precum: ceramice, metalice, oxidice, în vederea îmbunătățirii următoarelor caracteristici: biocompatibilitate, optice, anticorozive, lubrifiante, antiuzură, etc.
- ➔ Această tehnică este una dintre cele mai utilizate tehnologii fizice de depunere din vapori cu aplicabilitate în diferite domenii precum: medicină, inginerie electrică, electronică, aeronautică.

Parametri funcționali:

- ➔ Camera tehnologică din oțel inoxidabil amagnetic 450 mm $\pm$ 50 mm și H = 500mm $\pm$ 50 mm;
- ➔ Viteza de rotație de maxim 30 rot/min pentru portsubstraturi;
- ➔ Presiune limită sub 5×10^{-7} mbar și vid dinamic stabil cuprins între 5×10^{-1} - 5×10^{-4} mbar;
- ➔ Două magnetroane circulare cu ținta de pulverizare de 5 cm;
- ➔ 2 gaze de lucru: Ar-gaz de bombardament și N₂-gaz reactiv;
- ➔ Sursa de cc de minim 500W pentru alimentarea unui catod de pulverizare;
- ➔ Sursa de RF de minim 300W; Sursa de cc-pulsat de minim 500W.



Contact pentru servicii in cadrul PHOENIX:

Mariana Lucaci (mariana.lucaci@icpe-ca.ro)
Georgeta Velciu (georgeta.velciu@icpe-ca.ro)
Tel: 021 346 72 31
Fax: 021 346 82 99

